PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-139222

(43) Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.Cl.

CO8J 5/00

CO8G 69/44

// CO8L 77:00

(21)Application number : 02-263629

(71)Applicant: MITSUBISHI KASEI CORP

(22)Date of filing:

01.10.1990

(72)Inventor: ODA FUMIHIKO

(54) PRODUCTION OF HIGH POLYMER MOLDED ARTICLE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the highly oriented title molded article being excellent in mechanical characteristics such as modulus by applying a magnetic field to a thermally transferable liquid crystalline high polymer which is a wholly aromatic polyesteramide in a liquid crystal state.

CONSTITUTION: A magnetic field is applied to a thermally transferable liquid crystalline high polymer which is a wholly aromatic polyesteramide synthesized from a combination of two or more kinds of compound respectively selected from aromatic diamine, aromatic dicarboxylic acid and aromatic diol compound and from aromatic aminocarboxylic acid, aromatic oxycarboxylic acid and aromatic oxyamino compound, etc., in a liquid crystal state to provide the objective molded article.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-139222

@Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月13日

C 08 J 5/00 C 08 G 69/44 // C 08 L 77:00 CFG NSR 8517-4F 9053-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称

高分子成形体の製造方法

②特 顧 平2-263629

20出 額 平2(1990)10月1日

@発明者

総田

文 彦

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社

総合研究所内

切出 顧 人

三菱化成株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

個代 理 人

弁理士 長谷川 一

外 1 名

明 福 書

1 発明の名称

高分子成形体の製造方法

2 特許請求の毎期

(1) 熱液晶性高分子に液晶状態で磁場を印加して高分子成形体を製造する方法において、熱液晶性高分子が全芳香族ポリエステルアミドであることを特徴とする高分子成形体の製造方法。

3 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は高分子成形体の製造方法に関する。詳しくは、磁場を用いて高分子成形体を製造する方法に関する。

〔従来の技術とその舞題〕

ポリマー成形体の弾性率は分子額の配向に依存 する。高分子の分子額の配向を達成する手段とし ては各種の延伸、液晶筋糸等が開発されてきた。 しかし、これらの技術によって成形される製品は、 フィルムやファイバー等に限られていた。

一方、磁場を被晶性高分子に作用させる方法が

任意の形状を有する成形体における分子配向手段 として注目される。しかしながら磁場による配向 のエネルギーは比較的小さいことから、液晶性高 分子を配向させることには解決すべき問題が多い。 【課題を解決するための手段】

高弾性率と磁場配向性の両方を換たすポリマー の化学構造について検討を行った結果、本発明に 到達した。

即ち、本発明は、熱液晶性高分子に液晶状態で 磁場を印加して高分子成形体を製造する方法において、熱液晶性高分子が全芳香族ポリエステルア ミドであることを特徴とする高分子成形体の製造 方法である。

以下、本発明を詳述べる。

熱液晶性高分子は加熱溶融時に液晶を形成する 高分子であり、各種の高分子が知られている。 磁 場の作用によって高分子観を高度に配向させるに は、磁場による配向エネルギーが小さいため比較 的分子量の低いあるいは低粘度のポリマーが好ま しい。一方、成形体の力学特性については、一般

特開平4-139222 (2)

に分子量の高い方が好ましい。この矛盾する2つの要求を満すにはポリマーの化学構造が重要である。本発明では熱液晶性高分子として全芳香族ポリエステルアミドを用いる。

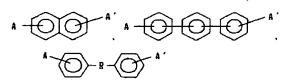
全芳香族ポリエステルアミド自体は公知であり、 芳香族環同志をエステル結合とアミド結合で連結 した主領構造を有する熱液晶性高分子であり、好 ましくは主額がエステル結合で構成され50モル %以下のアミド結合を有するものがあげられる。

全芳香族ポリエステルアミドとして好ましいものとしては、以下に示す芳香族ジアミン、芳香族ジカルボン酸、芳香族ジオール化合物、あるいは芳香族アミノカルボン酸、芳香族オキシカルボン酸、芳香族オキシアミノ化合物あるいはこれらの機能性誘導体、これらの核置換化合物から選ばれる2種以上の組合せから合成される全芳香族ポリエステルアミドである。

$$A - \bigcirc A'$$

3,3'-ジメチルー4,4'-ジアミノピフェニル、3,3'-ジクロルー4,4'-ジアミノピフェニル、2,2'-ジクロルー4,4'-ジアミノピフェニル、2,2'-ジメチルー4,4'-ジアミノピフェニル、2,6-ナフタレンジァミノピフェニル、1,4-アミノジフェニルンジアミン、3,3'-ジメチルー4,4'-ジアミノンジアミン、カージスでは1,4-フェニレンジアミン、クロルー1,4-フェニレンジアミン、カージメチルー4,4'-ジアミノピフェニル、2,6-ナフタレンジアミンである。

芳香族ジカルボン酸の好ましい具体例はテレフタル酸、イソフタル酸、ピスー 4 ーカルボキシルフェニルー1. 4 ーベンゼン、4. 4 ーカルボキシルジフェニル、ナフタリン~2. 6 ージカルボン酸、ナフタリン~1. 5 ージカルボン酸、ジ



ここで、A. A': - O H. - C O O H. - N H. およびこれらの概能性誘導体

また芳香環はアルキル基、アルコキシ基、フェニル基、フェノキシ基、ハロゲン基で置換されていても良い。

芳香族ジアミンの具体例としては、1、4-フェニレンジアミン、メチル-1、4-フェニレンジアミン、クロル-1、4-フェニレンジアミン、

フェニルケトンー4、4′ージカルボン酸、メチルテレフタル酸、クロロテレフタル酸、フェニルテレフタル酸、2、5ージメチルテレフタル酸、ジフェニルー3、3′ージメチルー4、4′ージカルボン酸である。

芳香族ジオールの好ましい具体例は、クロルハイドロキノン、メチルハイドロキノン、2.6ージヒドロキシナフタレン、1.4ージヒドロキシナフタレン、4.4′ージヒドロキシピフェニル、3.3′ージメチルー4.4′ージヒドロキシジフェニル、アセトキシハイドロキノン、ニトロハイドロキノン、ジメチルアミノハイドロキノン、1.5ージヒドロキシナフトール、1.6ージヒドロキシナフトール、ピス(4ーヒドロキシフェニル)-1.4ーベンゼンである。

芳香族アミノカルボン酸の好ましい具体例は、 pーアミノ安息香酸、mーアミノ安息香酸、6 ー アミノー2 ーナフトエ酸、4 ーアミノー1 ーナフ トエ酸、pーアミノー o ーメトキシ安息香酸、p ーアミノー o ークロロ安息香酸等である。

特朗平 4-139222(3)

芳香族オキシカルボン酸の好ましい具体例は、 2 ーヒドロキシー 6 ーカルボキシルナフタレンー pーヒドロキシ安息香酸、mーヒドロキシ安息香酸、 4 ーヒドロキシピフェニルカルボン酸、 4 ー ヒドロキシー 4′ーカルボキシジフェニルエーテル、 2 ークロローpーヒドロキシ安息香酸等である。

芳香族オキシアミノ化合物の好ましい具体例は pーアミノフェニル、4ーアミノー4'ーヒドロ キシージフェニル、4ーアミノー1ーナフトール、 3ーメチルー4ーアミノフェニル、Nーメチルー 4ーアミノフェノール、3ーアミノフェノール、 3ーメチルー4ーヒドロキシー4'ーアミノージ フェニルである。

重合は公知の方法に従い、アセチル化されたアミノ基および水酸基とカルボン酸基の反応を加熱 溶験状態で行う方法により全芳香族ポリエステルアミドが得られる。

全汚香族ポリエステルアミドが磁場配向に通す る理由は明らかではないが、異種結合による結晶

本発明で製造する成形体としては例えば繊維、フィルム、仮および種々の形状を持つ3次元的成形品等が挙げられる。

(実施例)

以下、本発明を実施例により詳述するが本発明 はその要旨を超えない限り、実施例に限定される ものではない。

実施例1および比較例1

本発明は、上述の液晶性全芳香族ポリエステル アミドを溶融し、例えば押出あるいは射出成形に て成形体を製造する際、あるいは成形後再加熱し て液晶を形成している状態で磁場を印加する。

磁場を作用させる方法としては、全方香族ポリエステルアミドを加熱し、ネマチック液晶状態の溶験物を磁場中に必要な時間保持すればよい。こ

2 - アセトキシー 6 - カルボキシナフタレン (0.4 モル)、テレフタル酸 (0.1 モル)、 p ー アミノフェノール (0.1 モル) から溶融重合により無液晶性ポリエステルアミドを合成した。このポリマーの動的溶融粘度をコーンブレート型粘度計を用いて310℃、2×10⁻¹ Hz で測定したところ10⁻¹ ポイズであった。

このポリマーに330でで20分間、100キロガウスの磁場を作用させて直径1mのロッドを成形した。このロッドは54GPa(室温、110Hzスパン15mで例定)の非常に高い動的曲げ弾性率を示した。

比較のため上記のポリマー組成においてp-アミノフェノールの代りにクロルハイドロキノンを使用したポリマーを同様に合成した。

このポリマーの溶融粘度を前記と同様にして測定したところ、800ポイズであった。また、前記と同一の方法、条件により成形した直径1mのロッドの弾性率は35GPaと本発明の方法に比べて小さいものであった。

特朗平4-139222 (4)

(発明の効果)

本発明方法によれば、高配向した弾性率等の機 被特性に優れた高分子成形体を得ることができる。

出 顧 人 三菱化成株式会社 代 理 人 弁理士 長谷川 一 (ほか1名)